

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載

【部門区分】第 7 部門第 2 区分

【発行日】令和 7 年 7 月 10 日(2025.7.10)

【公開番号】特開 2024-4794(P2024-4794A)

【公開日】令和 6 年 1 月 17 日(2024.1.17)

【年通号数】公開公報(特許)2024-009

【出願番号】特願 2022-104633(P2022-104633)

【国際特許分類】

H 1 0 F 39/18(2025.01)

H 1 0 D 84/80(2025.01)

H 1 0 D 84/83(2025.01)

H 1 0 D 84/85(2025.01)

H 0 4 N 25/70(2023.01)

H 0 4 N 25/60(2023.01)

10

【F I】

H 0 1 L 27/146 F

H 0 1 L 27/06 1 0 2 A

H 0 1 L 27/088 C

H 0 1 L 27/088 E

H 0 1 L 27/092 G

H 0 4 N 5/369

H 0 4 N 5/357

20

【手続補正書】

【提出日】令和 7 年 6 月 20 日(2025.6.20)

【手続補正 1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

30

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項 1】

光電変換素子を有する第 1 基板と、

前記光電変換素子から出力される信号電荷である電子を増幅する増幅トランジスタおよび前記増幅トランジスタのソースと電氣的に接続可能な選択トランジスタを有する第 2 基板と、

を備える光電変換装置であって、

前記光電変換素子は前記電子を蓄積する N 型の半導体領域を備え、

前記増幅トランジスタおよび前記選択トランジスタは P 型の MOS トランジスタであることを特徴とする光電変換装置。

40

【請求項 2】

前記第 1 基板は前記電子を前記増幅トランジスタに転送する転送トランジスタを有し、前記転送トランジスタは N 型の MOS トランジスタであることを特徴とする請求項 1 に記載の光電変換装置。

【請求項 3】

前記第 2 基板は、リセットトランジスタと F D 容量切り替えトランジスタを有し、前記リセットトランジスタと前記 F D 容量切り替えトランジスタは P 型の MOS トランジスタであることを特徴とする請求項 1 に記載の光電変換装置。

【請求項 4】

50

前記増幅トランジスタのゲートは、P型のポリシリコンにより形成されていることを特徴とする請求項1に記載の光電変換装置。

【請求項5】

前記増幅トランジスタのゲートは、N型のポリシリコンにより形成されていることを特徴とする請求項1に記載の光電変換装置。

【請求項6】

前記第2基板はリセットトランジスタとF D容量切り替えトランジスタを有し、前記リセットトランジスタとF D容量切り替えトランジスタはN型のM O Sトランジスタであることを特徴とする請求項1に記載の光電変換装置。

【請求項7】

前記第2基板は、リセットトランジスタとF D容量切り替えトランジスタを有し、前記リセットトランジスタと前記F D容量切り替えトランジスタは異なる導電型のM O Sトランジスタであることを特徴とする請求項1に記載の光電変換装置。

10

【請求項8】

前記第2基板は前記第1基板に積層されることを特徴とする請求項1に記載の光電変換装置。

【請求項9】

前記第1基板は、前記光電変換素子が配された第1半導体部材と、第1絶縁膜と、を有し、前記第2基板は、前記増幅トランジスタのソース領域が配された第2半導体部材と、第2絶縁膜と、を有し、前記第1半導体部材、前記第1絶縁膜、前記第2半導体部材、前記第2絶縁膜の順に配されることを特徴とする請求項1に記載の光電変換装置。

20

【請求項10】

前記増幅トランジスタから出力される画素信号を処理するロジック回路を有する第3基板を備えることを特徴とする請求項1に記載の光電変換装置。

【請求項11】

前記第2基板は、リセットトランジスタを有し、前記リセットトランジスタに供給される第1電源電圧と前記増幅トランジスタに供給される第2電源電圧とが異なることを特徴とする請求項1に記載の光電変換装置。

【請求項12】

前記第2基板は、リセットトランジスタを有し、前記リセットトランジスタに供給される第1電源電圧は、基準電圧より大きく、前記増幅トランジスタに供給される第2電源電圧より小さいことを特徴とする請求項1に記載の光電変換装置。

30

【請求項13】

前記光電変換素子のアノードに負バイアスを印加することを特徴とする請求項12に記載の光電変換装置。

【請求項14】

前記第3基板は前記第2基板に積層されることを特徴とする請求項10に記載の光電変換装置。

【請求項15】

前記第1基板は浮遊拡散部を有し、前記第2基板の深さ位置を貫通する配線構造体が前記浮遊拡散部に電氣的に接続することを特徴とする請求項1に記載の光電変換装置。

40

【請求項16】

前記配線構造体は、前記増幅トランジスタのゲートに電氣的に接続することを特徴とする請求項15に記載の光電変換装置。

【請求項17】

請求項1乃至16のいずれか1項に記載の光電変換装置を備える機器であって、
前記光電変換装置に対応した光学装置、
前記光電変換装置を制御する制御装置、
前記光電変換装置から出力された信号を処理する処理装置、
前記光電変換装置で得られた情報を表示する表示装置、

50

前記光電変換装置で得られた情報を記憶する記憶装置、および、

前記光電変換装置で得られた情報に基づいて動作する機械装置、の少なくともいずれかを更に備えることを特徴とする機器。

【請求項 18】

光電変換素子を有する第 1 基板と、

前記光電変換素子から出力される信号電荷である電子を増幅する増幅トランジスタおよび前記増幅トランジスタのソースと電氣的に接続可能な選択トランジスタを有する第 2 基板と、

を備える積層体であって、

前記光電変換素子は前記電子を蓄積する N 型の半導体領域を備え、

10

前記増幅トランジスタおよび前記選択トランジスタは P 型の MOS トランジスタであることを特徴とする積層体。

【請求項 19】

前記増幅トランジスタから出力される画素信号を処理するロジック回路を有する第 3 基板を備え、前記第 3 基板は前記第 2 基板に積層されることを特徴とする請求項 18 に記載の積層体。

【手続補正 2】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0006

【補正方法】変更

20

【補正の内容】

【0006】

本明細書の一開示によれば、光電変換素子を有する第 1 基板と、前記光電変換素子から出力される信号電荷である電子を増幅する増幅トランジスタおよび前記増幅トランジスタのソースと電氣的に接続可能な選択トランジスタを有する第 2 基板と、を備える光電変換装置であって、前記光電変換素子は前記電子を蓄積する N 型の半導体領域を備え、前記増幅トランジスタおよび前記選択トランジスタは P 型の MOS トランジスタであることを特徴とする光電変換装置が提供される。

30

40

50